#### 命题: Z 验题: M

# NJUIC 《半导体物理学》期中模拟考试试卷

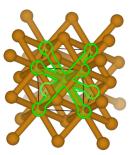
#### 一、(30 分) 简答

- 1. 什么是晶体点阵? 和晶体结构的关系是什么? 原胞取法唯一吗?
- 2. 晶体的晶面是什么? 密勒指数是什么(仅考虑立方晶系),该如何确定?
- 3. 倒空间如何理解? 正空间 WS 原胞与倒空间的第一布里渊区分别是如何选取的?
- 4. 能带理论中,周期场近似是什么?紧束缚近似是什么?布洛赫波函数是怎样的?
- 5. 如何理解电子共有化运动? 能带是连续的吗?
- 6. 如何定义有效质量? 其意义是什么? 什么是间接带隙半导体?
- 7. 晶体的本征缺陷有哪些? 掺杂为什么能够改变半导体导电性能?
- \*. 你如何理解什么是半导体?

#### 二、(10 分)

晶体结构的确定对了解晶体的性质非常重要, X 射线衍射是确定晶体结构的重要手段.

- 1. 常见的铝晶体是一种面心立方堆积结构,Z 同学用  $\lambda_1 = 1.54 \times 10^{-10} \mathrm{m}$  的 X 射线做衍射分析,结果得到(110)面的衍射角  $\theta_1$  约为 22.3°. 请给出晶体中一个铝原子的最近邻原子数,并分析上述结果的合理性.
- 2. Z 同学又使用波长  $\lambda_2 = 0.071$ nm 的射线对一铁晶体做衍射分析,发现随着衍射角从零开始增大,最早在  $\theta_2 = 10.1^\circ$  时出现衍射峰. 查阅资料知常温下铁晶体结构如下,晶格常数为 2.87Å. 请给出该衍射峰对应晶面的晶面指数,并计算铁晶体原胞的体积.



#### 三、(12分)

与原子核的分裂与结合一样, 晶体的形成常常伴随着能量的释放. 考虑一个由两种二价离子 (各 $N \uparrow \uparrow, N \to +\infty$ ) 等间距组成的一维晶体,相互作用能为

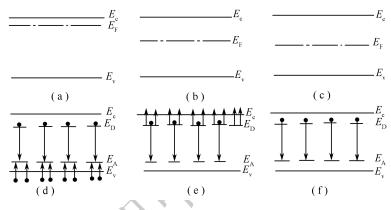
$$U(r) = -\frac{1}{2} \cdot 2N \left[ \frac{z_1 z_2 e^2}{4\pi\varepsilon_0 r} \sum_{i(\neq j)}^{2N} (\pm \frac{1}{a_i}) - \frac{B}{r^n} \right]$$

- 1. 请计算该晶体的 Madelung 常数  $\alpha = \sum_{i(\neq j)}^{N} (\pm \frac{1}{a_i})$ .
- 2. 若 n=4, 请计算单离子的结合能  $E=u(r_0)$ , 可用平衡间距  $r_0$  表示.
- 3. 若  $r_0 = 0.3$ nm, 结合能 E = 3 eV, 试求 B.

#### 四、(12分)

考虑室温 300 K 环境下一掺杂半导体硅,其  $N_{\rm c}=2.8\times 10^{19}{\rm cm}^{-3}\,,\;E_{\rm g}=1.12{\rm eV}.$ 

- 1. 半导体中首先掺杂了磷原子,使其费米能级来到导带底部下侧 0.3 eV 处,试计算磷的掺杂浓度并绘制能带图,体现出电离过程. 设杂质磷的电离能为 0.04 eV.
- 2. 对上述硅继续掺杂硼原子,使得费米能级降低了 0.1 eV,试计算硼的掺杂浓度. 假设均能全部电离.
- 3. 请简述下列各个能带图分别表明半导体处于何种掺杂情况,并分别指出哪个符合上述 1、2 小题的半导体掺杂情况.



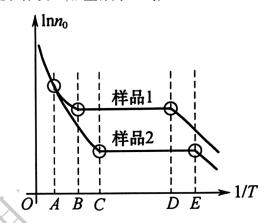
#### 五、(12 分)

- 一块有杂质补偿的硅材料,已知掺入受主密度  $N_{\rm A}=1\times10^{15}{\rm cm}^{-3}$ ,室温下测得其  $E_{\rm F}$  恰好与  $E_{\rm D}$  重合,并得知平衡电子密度为  $n_0=5\times10^{15}{\rm cm}^{-3}$ . 已知室温下硅的本征载流子密度  $1\times10^{10}{\rm cm}^{-3}$ ,导带底有效态密度  $2.8\times10^{19}{\rm cm}^{-3}$ .
  - 1. 请计算平衡少子浓度与  $E_{\rm F}$  的位置.
  - 2. 请计算掺入材料中的施主杂质浓度以及电离程度.
- 3. 导带底有效态密度  $N_{\rm c} \propto T^{\frac{3}{2}}$ ,请证明强电离条件下有  $E_{\rm F}=E_{\rm c}+kT\ln\frac{N_{\rm D}-N_{\rm A}}{N_{\rm c}}$ ,并简单说明该硅材料在  $T=400{\rm K}$  时的电离情况.

### 六、(12分)

Z 同学采购了两块硅材料,是杂质相同但浓度不同的两块 n 型硅. 测量得到其电子浓度与温度的关系如图所示. 试分析以下问题.

- 1. 两样品掺杂浓度较高的是哪个, 在  $T_A$  左侧为什么两曲线近似重合.
- 2. 两曲线在  $T_C$  与  $T_D$  之间为什么近乎平行,为什么两平行曲线的起点  $T_B$ 、 $T_C$  的不一致,终点  $T_D$ 、 $T_E$  也不一致.
  - 3. 若低温下, $N_c$  近乎不变,则在  $T_E$  右侧两曲线是否平行,其斜率的含义是什么.
  - 4. 请直接在图中绘制样品 2 的本征载流子浓度与温度的关系(纵坐标为  $\ln n_i$ ).



## 七、(12分)

Z 同学有一个 n 型锗样品,在 300K 环境下,其电子浓度  $n_0=5\times 10^{14} {\rm cm}^{-3}$ ,试计算上述温度时掺杂锗的电导率  $\sigma$ . 已知  $\mu_{\rm n}=3800 {\rm cm}^2/({\rm V}\cdot{\rm s})$ 、 $\mu_{\rm p}=1900 {\rm cm}^2/({\rm V}\cdot{\rm s})$ 、 $n_{\rm i}=2.33\times 10^{12} {\rm cm}^{-3}$ .